

登録番号	第 00066 号		
登録年月日	平成22年10月6日	登録区分	第二種

名称 (型式等)	ファインパターン・プロジェクション・マスク・アライナ (ステッパ) FPA-141F		
所在地	東京都大田区		
	キヤノン株式会社		
所有者 (管理者)	キヤノン株式会社		
製作者(社)	キヤノン株式会社		
製作年	1975年		
選定理由	<p>半導体製造のフォトリソグラフィ工程で、原版（フォトマスク）のパターンをウエーハに4分の1倍に縮小投影する装置である。投影レンズの倍率を等倍ではなく縮小にすれば原版のパターンより細い線幅で露光できる原理を利用したものである。当時はステッパという言葉がなかったのがこのように呼ばれたが、ステッパの草分け的存在であり、世界で初めて1ミクロン以下（サブミクロン）の露光を可能にした。前年にインテルから4kbitDRAMが販売されたが、本機の精細度はDRAMに換算すると256kbitに相当するものであった。</p>		
登録基準	1 — 口		

公開・非公開	非公開
--------	-----



その他参考となるべき事項	
--------------	--